

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】令和 2 年 2 月 27 日 (2020.2.27)

【公開番号】特開 2017-201008 (P2017-201008A)

【公開日】平成 29 年 11 月 9 日 (2017.11.9)

【年通号数】公開・登録公報 2017-043

【出願番号】特願 2017-88968 (P2017-88968)

【国際特許分類】

C 0 8 G 77/04 (2006.01)

C 0 9 K 3/18 (2006.01)

C 0 9 D 183/04 (2006.01)

C 0 9 D 7/40 (2018.01)

【F I】

C 0 8 G 77/04

C 0 9 K 3/18 1 0 4

C 0 9 D 183/04

C 0 9 D 7/12

【手続補正書】

【提出日】令和 2 年 1 月 17 日 (2020.1.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 8】

有機ケイ素化合物 (A 1) としては、炭素数が 6 ~ 20 のアルキル基を 1 つと、加水分解性基を 3 つ有する化合物；炭素数が 6 ~ 20 のアルキル基を 1 つと、第 2 の炭化水素鎖含有基を 1 つと、加水分解性基を 2 つ有する化合物；等を好ましく挙げることができる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 4 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 4 4】

低沸点溶媒 (D) の 20 での蒸気圧は 2000 Pa 以上が好ましく、より好ましくは 3000 Pa 以上であり、上限は特に限定されないが、例えば 13000 Pa である。また低沸点溶媒 (D) の沸点は、好ましくは 100 以下であり、より好ましくは 85 以下である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 5 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 5 4】

前記リン系酸化防止剤としては、トリス (2, 4 - ジ - t - ブチルフェニル) ホスファイト、ビス (2, 4 - ジ - t - ブチルフェニル) ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス (2, 6 - ジ - t - ブチル - 4 - メチルフェニル) ペンタエリスリトールジホスファイト、

イト、ビス(2, 4-ジ-クミルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト、テトラキス(2, 4-ジ-t-ブチルフェニル)-4, 4'-ビフェニレンジホスフォナイト、ビス-[2, 4-ジ-t-ブチル-(6-メチル)フェニル]エチルホスファイト等が挙げられる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0158

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0158】

前記防カビ剤/抗菌剤としては、2-(4-チアゾリル)ベンズイミダゾール、ソルビン酸、1, 2-ベンズイソチアゾリン-3-オン、(2-ビリジルチオ-1-オキシド)ナトリウム、デヒドロ酢酸、2-メチル-5-クロロ-4-イソチアゾロン錯体、2, 4, 5, 6-テトラクロロフタロニトリル、2-ベンズイミダゾールカルバミン酸メチル、1-(ブチルカルバモイル)-2-ベンズイミダゾールカルバミン酸メチル、モノあるいはジブロモシアノアセトアミド類、1, 2-ジブロモ-2, 4-ジシアノブタン、1, 1-ジブロモ-1-ニトロプロパノールおよび1, 1-ジブロモ-1-ニトロ-2-アセトキシプロパン等が挙げられる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0175

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0175】

式(1)中、Z^{a3}の炭化水素鎖含有基は、いずれも上記説明した第1の炭化水素鎖含有基(炭素数が6~20のアルキル基を含む)、第2の炭化水素鎖含有基の範囲から適宜選択できる。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0192

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0192】

得られた皮膜において、構造(a₁)と構造(b)の存在比(構造(a₁)/構造(b))は、モル基準で、0.01以上であることが好ましく、より好ましくは0.02以上、さらに好ましくは0.03以上であり、0.3以下であることが好ましく、より好ましくは0.2以下、さらに好ましくは0.1以下、よりいっそう好ましくは0.09以下である。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0216

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0216】

塗布溶液1-1をベンコット(旭化成株式会社製クリーンルーム用ワイパー、登録商標)に浸み込ませ、アルカリ洗浄したガラス基板(5cm×5cm、Corning社製「EAGLE XG」)にコーティングし、1日室温で静置した。コーティングは以下の方法によりおこなった。ベンコットの上に疑似指(トンボ社製モノワンドاستキャッチ)を2本乗せ、スチールウール試験機(大栄精機社製)に取り付け、ベンコットに塗布溶液1-1を1mL浸み込ませた。次いで1kgの荷重を加えながら、ストローク50mm、速

度 60 r/min の条件で基材に往路のみ塗布し、時間を置かずにガラス基板をずらして重なり合う箇所ができるように、再度往路のみ塗布した。このように塗布を行うことにより、定量的に手塗りを再現することができる。このコーティング方法を手塗りということがある。

【手続補正 8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0240

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0240】

比較例 7

ドデカンに代えて 1, 2-ジメトキシエタンを用いたこと以外は比較例 6 と同様にして、塗布溶液 g を作製した。この塗布溶液 g を用いて、実施例 1 - 1 と同様にしてガラス基板に手塗りでコーティングし、1 日室温で静置して皮膜を作製し、評価した。